

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016年9月29日(29.09.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/151644 A1

- (51) 国際特許分類:
B24B 55/03 (2006.01) C11D 7/12 (2006.01)
B08B 3/08 (2006.01) C11D 17/08 (2006.01)
C03C 15/00 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/003011
- (22) 国際出願日: 2015年6月16日(16.06.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-063097 2015年3月25日(25.03.2015) JP
- (71) 出願人: パナソニックIPマネジメント株式会社 (PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5406207 大阪府大阪市中央区城見2丁目1番61号 Osaka (JP).
- (72) 発明者: 西川 晴香(NISHIKAWA, Haruka). 家田 智之(IEDA, Toshiyuki). 島田 和哉(SHIMADA, Kazuya).
- (74) 代理人: 廣幸 正樹(HIROKOH, Masaki); 〒5300047 大阪府大阪市北区西天満3丁目1番6号 辰野西天満ビル Osaka (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユー

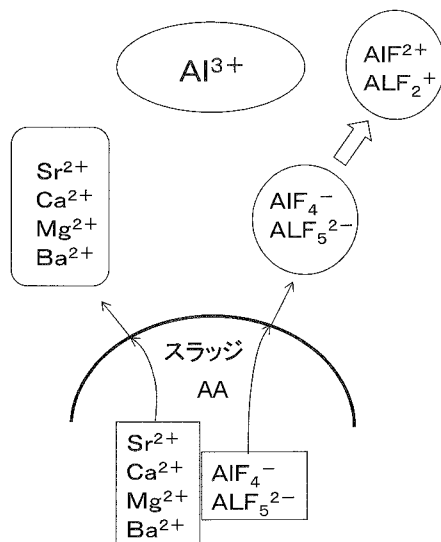
[続葉有]

(54) Title: WASHING LIQUID AND WASHING METHOD FOR GLASS POLISHING DEVICE

(54) 発明の名称: ガラス用研磨装置の洗浄液および洗浄方法

(57) Abstract: When an alkali-free glass is polished with a polishing liquid that comprises hydrofluoric acid as a main component, sludge is generated on the glass surface and in a reservoir and piping of a polishing device, which causes problems such as degradation in quality and stop of the device. A washing liquid capable of dissolving sludge that is generated in a glass polishing device and contains aluminum and fluorine, said washing liquid being characterized by containing Al^{3+} ion and capable of dissolving sludge formed by the binding of Al and F to divalent elements such as Mg, Ca, Sr and Ba. The aforesaid problems can be resolved by washing the inside of a polishing device with this washing liquid.

(57) 要約: 無アルカリガラスをフッ化水素酸を主成分とする研磨液で研磨すると、ガラス表面上や、研磨装置の貯留部および配管内でスラッジが発生し、品質劣化、装置の停止といった問題が発生する。ガラス研磨装置で生成するアルミニウムとフッ素を含むスラッジを溶解する洗浄液であって、 Al^{3+} イオンを含むことを特徴とする洗浄液は、AlとFおよびMg、Ca、Sr、Baといった2価の元素が結合してできたスラッジを溶解させることができる。この洗浄液を用いて研磨装置内を洗浄することで課題は解決される。



AA Sludge



ロシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨー
ロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE,
ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV,
MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK,
SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))